PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-218680

(43) Date of publication of application: 29.09.1986

(51)Int.Cl.

C09K 3/14 B24B 37/04

(21)Application number : **60-061415**

(21)Application number

(71)Applicant : SANYO CHEM IND LTD

(22)Date of filing:

25.03.1985

(72)Inventor: GENJIDA FUMIHIDE

KAWACHI TOMIO

(54) LIQUID FOR POLISHING

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a polishing liquid containing abrasive grains resistant to precipitation with time and feedable stably to a polisher, by using a water-soluble polymer containing an essential constituent component comprising an unsaturated monomer having a specific functional group.

CONSTITUTION: Diamond abrasive grains are dispersed in a dispersion medium composed of water and a water-soluble polymer containing an essential constituent component comprising a monoethylenic unsaturated monomer having carboxylic acid (salt) group, amino group, hydroxyl group, ether group, amide group or quaternary ammonium salt group. The viscosity of the polishing liquid can be varied from a low level to a high level according to the use by changing the content and the molecular weight of the polymer.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's

decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-218680

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)9月29日

C 09 K 3/14 B 24 B 37/04 6683-4H 7712-3C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

劉発明の名称 研磨加工液

到特 顧 昭60-61415

②出 願 昭60(1985)3月25日

個発 明 者

源氏田

文 秀

八幡市男山雄徳8

⑫発 明 者

河 内

富雄

京都市東山区今熊野南谷町4-18

⑪出 願 人

三洋化成工業株式会社

京都市東山区一橋野本町11番地の1

明 細 1

 発明の名称 研磨加工液

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. カルボン酸(塩)基、アミノ基、水酸基、エーテル基、アミド基および第4級アンモニウム塩基からなる群より選ばれる基を含有するモノエチレン性不飽和単量体(a)を必須構成成分とする水溶性重合体(A)・水およびダイヤモンド低粒を含有することを特徴とする研磨加工液。
 - 2. (a)がカルポン酸(塩)基および/またはアミノ基合有モノエチレン性不飽和単量体である特許請求の範囲第1項記載の加工液。
 - 8. (A)の含有量が加工液の重量に基づいて 0.1 ~50%である特許請求の範囲第1項または第2項記載の加工液。
 - 4. ダイヤモンド砥粒の平均粒径が20μ以下である特許請求の範囲第1項~第3項のいずれか一項に記載の加工液。

- 5. ダイヤモンド砥粒の含有量が加工液の重量 に基づいて、0.1~10%である特許請求の範 囲第1項~第4項のいずれか一項に配載の加 工液。
- 8. 発明の詳細な説明
- 〔産業上の利用分野〕

本発明は研磨加工液に関するものである。

〔従来の技術〕

従来、研磨加工液としてグリセリンのような増 粘剤を加えた水に、酸化マグネシウムなどの低粒 を混合したものがあつた(特開昭 55-189479 号公 報)。

しかしながらこのものは、砥粒が経時的に沈降 しやすいため、砥粒の含有量の少ない加工液が被 研磨材料に供給され研磨所要時間が長くなつたり、 加工液を供給する前にあらかじめ攪拌混合する必 要があり、作業性を著しく低下させるという問題 点を有している。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明者らは、砥粒が経時的に沈降しにくく、

安定に供給しやすい研磨加工液を得るべく鋭意検 討した結果、本発明に到達した。

(問題点を解決するための手段)

本発明は、カルボン酸(塩)基、アミノ基、水酸基、エーテル基、アミド基および第4級アンモニウム塩基からなる群より選ばれる基を含有するモノエチレン性不飽和単量体(a)を必須構成成分とする水溶性重合体(A)、水およびダイヤモンド低粒を含有することを特徴とする研磨加工液である。

本発明における水溶性重合体の必須構成成分であるモノエチレン性不飽和単量体としては、下記単量体およびこれらの二種以上の混合物があげられる。

- 1. カルボン酸(塩)基含有単量体
 - (1) カルボン酸基合有単量体:モノエチレン性不 飽和モノまたはポリカルボン酸たとえば(メ タ)アクリル酸(アクリル酸および/または メタアクリル酸を意味する。以下同様の表現 を用いる)、マレイン酸およびフマル酸。
 - (2)カルポン酸無水物基含有単量体:モノエチレ

ビニルピリジン類(2 - ビニルピリジン、4 - ビニルピリジン、N - ビニルピリジン)、N - ビニルピリジン)、N - ビニルイミダゾールまたはこれらとモノカルボン酸たとえば酢酸、プロピオン酸との塩。

- 8. 水酸基合有単量体:モノエチレン性不飽和アルコールにとえば(メタ)アリルアルコール:ポリオール(アルキレングリコール,グリセリン・ポリオキシアルキレングリコールなど)のモノエチレン性不飽和エステルたとえばヒドロキシエチル(メタ)アクリレート,トリエチレングリコール(メタ)アクリレートおよび特開昭 51-112447 号公報記載の単無体。
- 4. エーテル基含有単量体(但し水酸基含有以外のもの): モノエチレン性不飽和モノまたはポリカルボン酸のアルキレンオキシド付加型化合物のアルキル(Ci~Ci)エーテルたとえば(メタ)アクリル酸エチレンオキシド(2モル)付加物メチルエーテル、モノエチレン性不飽和アルコールのアルキル(Ci~Ci)エーテルたとえば(メ

ン性不飽和ポリカルボン酸無水物たと**えば**無水マレイン酸。

- (3) カルボン酸塩基含有単量体: モノエチレン性 不飽和モノまたはポリカルボン酸の水溶液 (アルカリ金属 (Na , K など) 塩 , アンモニウ ム塩 , アミン (アルカノールアミン たとえば トリエタノールアミン , 低級アルキルアミン たとえばメチルアミンなど) 塩 など 1 たとえ ば (メタ) アクリル酸ナトリウム , (メタ) アクリル酸トリエタノールアミン塩 , マレイ ン酸ナトリウム , マレイン酸メチルアミン塩。
- でこノ基合有単量体:モノエチレン性不飽和モノまたはジカルポン酸のアミノ基含有エステル(ジアルキルアミノアルキルエステル・ジヒドロキシアルキルアミノエステル・モルホリノアルキルエステルなど)たとえばジメチルアミノエチル(メタ)アクリレート・モルホリノエチル(メタ)アクリレート・ジメチルアミノエチルフマレート:複素環式ビニル化合物たとえば

タ)アリルアルコールのメチルエーテル、および特開昭 51-112447 号公報記載の単量体。

- 5. アミド基合有単量体:(メタ)アクリルアミド
 : N アルキル(メタ)アクリルアミドたとえ
 ぱ N メチルアクリルアミド: N ジアルキ
 ル(メタ)アクリルアミドたとえば N N'-ジャ
 チルアクリルアミド; N ヒドロキシアル
 (メタ)アクリルアミドたとえば N ヒドロキ
 シエチル(メタ)アクリルアミド; N,N'-ジャ
 ドロキシアルキル(メタ)アクリルアミド; N,N'-ジャ
 スぱ N,N-ジャドロキシエチル(メタ)アクリルアミド
 れば N,N-ジャンクタム類 たとえば N ビールピロリドンなど。
- 6. 第4級アンモニウム塩基含有単量体: N,N,NートリアルキルーNー(メタ)アクリロイロキシアルキルアンモニウム塩たとえばN,N,NートリメチルーNー(メタ)アクリロイロキシエチルアンモニウムクロリドおよび英国特許第1084296号記載の単量体。

以上の単量体のうち水溶性重合体を形成しやす

いという観点から好ましいものは、カルボン酸(塩)苺およびアミノ基合有単量体であり、特に好ましいものは(メタ)アクリル酸、(メタ)アクリル酸トリウム、(メタ)アクリルアミン塩、ジメチルアミノエチル(メタ)アクリレートと酢酸との塩、ジエチルアミノエチル(メタ)アクリレートとプロピオン酸との塩である。

本発明における単量体は該単量体と共重合しうる水不溶性単量体と併用してもよい。このような水不溶性単量体としてはエステル基合有単量体にとえばモノエチレン性不飽和カルボン酸の低級アルキル(C1~Ca)エステル(メチル(メタ)アクリレート。エチル(メタ)アクリレート。こことはより、アクリレートなど」にとえば
サルヘキシル(メタ)アクリレートなど」にとえば
サルヘキシル(メタ)アクリレートなど
サートのエステルによる有

体のトリエタノールアミン塩。

重合体 & 5 : マレイン酸/アクリル酸/ 2 - ヒドロキシエチルメタアクリレート
(80:60:10) 共重合体のトリエタ

上記において()内は単量体の重量比を示す。

ノールアミン塩。

このようにして得られた重合体は液状または固

レン系単量体 たとえばスチレン . α - メチルスチ レンなどがあげられる。

水不溶性単量体の含有量は全単量体中通常50重量%以下、好ましくは20重量%以下である。

本発明において使用する重合体としては、前述の単量体の単独または共重合体、前述の単量体と水不溶性単量体との水溶性共重合体が使用できる。 本発明における重合体を例示すれば下記の通り

重合体 1 : アクリル酸 1 2 - ヒドロキシエチルメタアクリレート 1 メチルアクリレート (78:26:1) 共重合体のナトリウム塩。

である。

重合体 MG 2 : ジメチルアミノエチルメタアクリレート重合体のプロピオン酸塩。

重合体 & 3 : マレイン酸 / アクリル酸 / メチルメ タアクリレート (80:60:10) 共重 合体のナトリウム塩。

重合体 M 4: アクリル酸/2-ヒドロキシエチル メタアクリレート (70:80) 共重合

本発明における重合体は特開昭 54-48188 号公報に記載の重合体と併用して使用することもできる。使用する場合、本発明における重合体は全重合体中で通常20重量%以上、好ましくは50重量%以上使用される。

本発明におけるダイヤモンド砥粒は天然から得られたものでも、また人工的に合成されたものでもよい。その平均粒径は通常 20 μ 以下好ましくは 10 μ 以下である。平均粒径が 20 μ より大きいものは、研磨所要時間は短縮されるが研磨加工面の表面粗さが大きくなり、さらに粒径の小さい砥粒を使用した加工液で再度研磨加工する必要がある。また水中に安定に分散させることが困難である。

本発明の加工液には必要により添加剤を加える ことができる。このような添加剤としては防錆, 防食剤たとえば有機アミン(モノエタノールアミ ン、トリエタノールアミン、シクロヘキシルアミ

特開昭61-218680(4)

ン、モルホリンなど)、有機アミン誘導体(上記アミンのアルキレンオキシド付加物、脂肪酸アミドなど)、脂肪族または芳香族カルボン酸(カブリル酸、オレイン酸、ダイマー酸、アルケニルコハク酸、安息香酸など)およびこれらカルボン酸のアルカリ金属塩、アミン塩など、PH調整剤たとえば上配アミンやアルカリ金属の水酸化物など、および消泡剤たとえばシリコーン化合物やポリエーテル化合物などをあげることができる。

本発明の加工液の処方を示せば下記の通りである。(%は加工液の重要に対する%で示す。)

重 合 体 通常 0.1.~ 5 0% (好ましくは 1 ~ 30 %)

ダイヤモント砥粒 通常 0.1~10%(好ましくは 0.2~5 %)

水 通常 35~99.8% (好ましくは 62 ~98.7%)

添 加 剤 通常 0 ~ 5 % (好ましくは 0.1 ~ 8 %)

上記において重合体の含有量が 0.1%より少ない

イ素系、窒化ケイ素系など)、金属(鋼、ステンレス、アルミニウム、鋼、ニツケルなど)、プラスチック(ナイロン、ポリアセタール、ポリカーボネート、変性ポリフエニレンオキサイドなど)、ガラスおよびこれらの複合材料(セラミツクーフエライトなど)があげられる。

このような被研磨材料は一般に従来より用いられているラッピングマシン(日本エンギス社製,スピードファム社製,ワシノ機械製,不二越機械工業製)などで研磨される。

本発明の加工液の適用法は、従来の加工液の適用法と同様でよく、たとえば研磨加工においてラッププレートに加工液を滴下またはスプレーすればよい。

〔実施例〕

以下実施例により本発明をさらに説明するが、 本発明はこれに限定されるものではない。実施例 中の%は重量基準である。

実施例1~10.比較例1~8

本発明の加工液を表一1の通り作成した。

とダイヤモンド砥粒を水中に安定に分散させる効果が小さくなり、また50%をこえると加工液の粘度が高くなり取扱いにくい。

ダイヤモンド低粒の含有量が 0.1%より少ないと 研磨所要時間が長くなり、また10%をこえると被 研磨材料表面の端ダレ量が大きくなり、 添加した だけの効果はみられず経済的に不利である。

本発明の加工液の製造は、あらかじめ重合体を 溶解させた水にダイヤモンド砥粒を混合して攪拌 により分散させる方法でも、また、重合体,水お よびダイヤモンド砥粒を同時に混合して攪拌によ り分散させる方法でもよい。添加剤成分は重合体 によりダイヤモンド砥粒を水に分散させた後でも、 またこれら 8 成分と同時に加えて溶解させてもよい。 攪拌方法としてはマグネチックスターラー、 羽根式攪拌機,ホモミキサーなどを用いる方法が あげられるがいずれの方法によつて攪拌してもよい。 また必要に応じて攪拌時加熱をしてもよい。

本発明の加工液が用いられる被研磨材料としては、セラミツクス(硅石系、アルミナ系、炭化ケ

安一 1

实 推 例	1	2	8	4	5	6	7	8	9	10
*	9 2.0	9 2.0	9 2.0	920	7 8.0	9 6.0	8 4.0	9 2.5	9 1.0	7 8.9
ダイヤ (平均粒径) モンド (0.05 d	1.0	1.0	1.0			0.5	6.Ö			
• (^{平均拉径}) 0.5 <i>a</i>				0.1				0.5.	2.0	
◆ (平均粒任) 5 g					1.0					1.0
亚合体专1 (約40%) 派1 水溶液	6.0			0.0		2.5				
型合体 (約40%) 成2 (於指度)		6.0			2 5.0			6.0	6.0	
双合体 (約40%) 延8 水形取			6.0				1 0.0			2 6.0
切 箱 剤	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	LO	1.0	1.0	1.0	1.0

★1 重合体 & 1 は発明の詳細な説明に記載の重合 ・体 & 1 を示す。(以下同様) 本発明の加工液および比較冷として市阪の 加工液を用いて行った極日安定性結果を表-2 に示す。

丑-2

				*	26 例					比较例			
和发吟 随	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3
0時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	o	0	0	0	0	0	0	Δ	×	×
3	0	0	0	o	О	o	0	0	0	0	×	×	×
5	0	0	0	0	Δ	0	0	0	0	0	×	×	×
10	0	0	0	0	∆~ X	Δ	0	0	Δ	0	×	×	×

なお比較例1および2は、いずれも平均粒径0.5 ルのダイヤモンド砥粒を1%含有する水を分散域とした加工液である。比較例3は特別で55-139479号公報の発明の幹細な説明に記載されている加工液の組成(粒径0.08~0.1ルの酸

ほとんど同じであったが、研修所要時間が約2/3に短縮され、かつ加工後の水洗処理も比較例1の2~3回に対し1回で十分であるとの結果を得た。尚、研修機械としてはエンギス社殿のハイブレス自動精密鏡面ラッピングマシンModel12を用いた。

[発明の効果]

本発明の加工液は下記の効果を奏する。

- (1) 加工液の分散安定性がよく、極時的に砥 粒が沈降しにくい。
- (2) 一定量のダイヤモンド砥粒を被研磨材に 安定に供給できるため作業性が向上する。

化マグネシウムをグリセリンと水の混合液に加えたもの)に増じて、酸化マグネシウムの代りに平均粒径0.4mのダイヤモンド砥粒を使用し、 ダイヤモンド砥粒1.0%、グリセリン2.5%および水96.5%の割合で混合したものである。

経時安定性試験は各加工液を変温で砂硬し、分散状態を内限で観察した。尚、表一2中の記号は次の通りである。

〇: 均一に分飲

△: やや分離

×:分離

表-2の結果から本発明の加工被は分散安 定性が極めて良好であることがらかる。

本流行[1] 1

実施例 8 の加工液を用いてセラミックとフェライトの複合材料よりなる磁気ヘッドを研磨 加工したところ、比較例 1 にくらべ要面根さは

に供給できるため作業性が向上する。



- (3) 重合体の含有量および分子量を変えることにより低粘度の加工液から高粘度の加工液まで目的にあわせたものを使用できる。
- (4) 高品質、高精度の研磨加工面を得ることができる。
- (5)水を分散媒にしているため火災の危険性がない。
- (6) 被研磨材料から加工液の除去が容易である。
- (7) 本発明の加工液はセラミツク、金属・ガラス・ プラスチックなどの材料の表面研磨に有用である。
- (8) 砥粒そのもののもつている特性を摂うことがない。

上記効果を奏することから、本発明の加工液は電子部品分野の著しい進歩に伴い望まれてきている電子部品材料の高品質、高精度の表面研磨加工に有用である。

特許出額人 三洋化成工業株式会

